

○場 所：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)東京本部別館
2階 セミナー室
(〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町)

○参加費用：無料(懇親会費 1,000 円)

○講演者：株式会社 FLOSFIA(フロスフィア) 営業部 國枝 浩二 様

○講演テーマ：『京都大学発 ミスト CVD 成膜技術と次世代パワーデバイス
技術の事業化への挑戦』

○講演概要：

株式会社 FLOSFIA は、真空ポンプを使わずにナノメートルの厚み制御も可能な「ミスト CVD 成膜技術」をコア技術として事業を展開している京都大学発のベンチャー企業である。

このミスト CVD 成膜技術に関する事業の展開や次世代パワーデバイスとして期待される酸化ガリウム半導体のデバイスの試作に世界で初めて成功したことなどから、第 2 回「JEITA ベンチャー賞」を受賞した。

2017 年 4 月以降だけでも日経テクノロジーオンライン、日刊工業新聞、電子デバイス産業新聞、に同社の関連記事が掲載されるなど、注目を集めている。

今回は、同社のミスト CVD 成膜技術と酸化ガリウムデバイスの開発と事業化にスポットを当て、その事業化と産学連携への取り組みについてご紹介頂く。

主 催：特定非営利活動法人産学連携学会

共 催：国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

後 援：医学系大学産学連携ネットワーク協議会(medU-net)

■申込方法：

こくちーず (<http://kokucheese.com/event/index/478037/>)

産学連携学会HP (<http://j-sip.org/>)

■お問い合わせ先■

産学連携学会事務局(担当 岩瀬、大嶋、須藤)

〒182-0024 東京都調布市布田 2-50-2 コーポ栄 101

(株)キャンパスクリエイト調布ブランチ内

TEL : 080-4203-5165 FAX : 042-490-5727

E-mail : j-sangaku@j-sip.org

以上